(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-330896

(43)公開日 平成9年(1997)12月22日

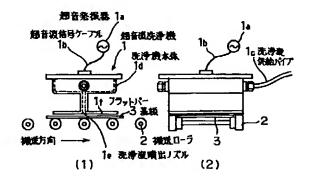
| (51) Int.CL.* | 識別記号 | 庁内整理番号 | ΡI | | | 技術表示箇所 |
|---------------|---------------------|--------|---------|---------|-----------------|------------|
| H01L 21/304 | 341 | | HO1L | 21/304 | 341 | N |
| | | | | | 341M | |
| B 0 6 B 1/20 | | | B06B | 1/20 | | |
| B 0 8 B 3/12 | | | B08B | 3/12 | | |
| G03F 7/30 | | | G03F | 7/30 | | |
| | | | 審查請求 | 未請求 | 請求項の数2 | OL (全 3 頁) |
| (21)出願番号 | 特顧平8 -150810 | | (71)出廣人 | 0001249 | 59 | |
| | | | | 株式会社 | Ŀカイジョー | |
| (22)出廣日 | 平成8年(1996) 6月12日 | | | 東京都习 | | 目1番地の5 |
| | | | (72)発明者 | 高橋多 | ex. | |
| | | | | 東京都等 | 附市条町3丁 [| 目1番地の5 株式 |
| | | | | 会社カイ | 「ジョー内 | |
| | | | (72)発明者 | 岡野 田 |) — | |
| | | | | 東京都平 | 对市条町3丁 | 1番地の5 株式 |
| | | | | 会社カイ | 「ジョー内 | |
| | | | (74)代理人 | 弁理士 | 若林 忠 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 1 | | | |
| | | | | | | |

(54) 【発明の名称】 超音波洗浄機

(57)【要約】

【課題】 超音波洗浄機の洗浄効率を高める。

【解決手段】 超音波洗浄機1は、搬送中の基板3との間でわずかな間隙を形成するように、洗浄液噴出ノズル1 eの端部から基板3の搬送方向および該方向と反対方向に基板3と平行に延び、洗浄液噴出ノズル1 eの長さと概ね同じ幅を有するフラットバー1 f を備えている。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 搬送される薄板状の被洗浄物の搬送方向 と直角な方向に延びる洗浄液噴出ノズルを備え、前記被 洗浄物の対向する面を洗浄する超音波洗浄機において、 搬送中の被洗浄物との間でわずかな間隙を形成するよう に、前記洗浄液噴出ノズルの端部から前記搬送方向およ び該方向の反対方向に前記被洗浄物と平行に延び、前記 洗浄液噴出ノズルの長さと概ね同じ幅を有するフラット バーを備えていることを特徴とする超音波洗浄機。

【請求項2】 前記フラットバーの搬送方向の両端が被 10 洗浄物と反対側に折り返されている、請求項1記載の超 音波洗浄機。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、シリコンウェハ 一、液晶ガラス基板を洗浄する超音波洗浄機に関する。 [0002]

【従来の技術】図4(1),(2)はこの種の超音波洗 浄機の従来例の正面図と側面図である。

【0003】超音波洗浄機4は、搬送ローラ2で搬送さ 20 れる基板3の表面を洗浄するもので、超音波発振器4 a と、超音波信号ケーブル4bと、洗浄液供給パイプ4 c、洗浄機本体4dと、基板3の搬送方向と直交な方向 に延びる洗浄液噴出ノズル4 eで構成されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上述した従来の超音波 洗浄機は、洗浄液噴出ノズルが細く絞り込まれた形状と なっているため、その下を通過する被洗浄物をその細い 先端部のみでしか洗浄できず、洗浄効果がよくなかっ た。

【0005】よって、洗浄効果を上げるためには、超音 波洗浄機を、図5に示すように、被洗浄物の搬送方向に 複数台並べて使用するしか方法がなかった。

【0006】本発明の目的は、1台で洗浄効果の高い超 音波洗浄機を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の超音波洗浄機 は、搬送中の被洗浄物との間でわずかな間隙を形成する ように、洗浄液噴出ノズルの端部から被洗浄物の搬送方 向および該方向の反対方向に被洗浄物と平行に延び、洗 40 浄液噴出ノズルの長さと概ね同じ幅を有するフラットバ 一を備えている。

【0008】ノズル下部に被洗浄物がない場合は洗浄液 はそのまま下部に落ちるが、下を被洗浄物が通過する際 には、フラットバーと被洗浄物との間に水の膜ができ、 そこを超音波が伝達するため、フラットバー全面で被洗 浄物を洗浄できる。

【0009】なお、フラットバーは強度的な問題(ソ リ、うねり)がなければ、大きい程よい。

【0010】本発明の実施態様によれば、フラットバー 50 【図2】図1のフラットバーの拡大断面図である。

の搬送方向の両端が被洗浄物と反対側に折り返されてい

【0011】したがって、洗浄後の液がフラットバーの 上面にかかって被洗浄物が再び汚れるのが防止される。 [0012]

【発明の実施の形態】次に、本発明の実施形態について 図面を参照して説明する。

【0013】図(1), (2)はそれぞれ本発明の一実 施形態の超音波洗浄機の正面図、側面図、図2は図1の 部分拡大断面図である。

【0014】本実施形態の超音波洗浄機1は、従来と同 じ超音波発振器1aと超音波信号ケーブル1bと洗浄液 供給パイプ1cと洗浄機本体1dと洗浄液噴出ノズル1 eに加えて、フラットバー1fを新たに備えている。

【0015】このフラットバー1 fは搬送中の基板3と の間でわずかな間隙を形成するように、洗浄液噴出ノズ ル1 eの端部から基板3の搬送方向および該方向と反対 方向に基板3と平行に延び、洗浄液噴出ノズル1eの長 さと概ね同じ幅を有している。

【0016】ノズル下部に被洗浄物である基板3がない 場合は洗浄液はそのまま下部に落ちるが、下を被洗浄物 である基板3が通過する際には、図2に示すように、フ ラットバー1fと基板3との間に水の膜ができ、そこ を、超音波が反射しながら伝達するため、フラットバー 全面で基板3を洗浄できる。

【0017】図3はフラットバー1fの他の例を示す断 面図である。このフラットバー1 f は基板3の搬送方向 の両端が上方に折り返され、これにより洗浄後の液がフ ラットバー1 fの上面にかかって基板3が再び汚れるの 30 が防止される。

【0018】なお、本実施形態の超音波洗浄機を基板3 の裏側にも設けて基板の裏面の洗浄を行うことができ る。ただし、この場合、フラットバーは搬送ローラ間に 入らなければならず、表側を洗浄する場合よりも長さが 短くなる。

【0019】また、以上の実施形態は、フラットバー1 fは洗浄液噴出ノズル1eと一体になっているが、洗浄 液噴出ノズル1 e に適宜な手段で後から取り付けられる ようにしてもよい。

[0020]

【発明の効果】以上説明したように本発明は、洗浄液噴 出ノズルの先端に、被洗浄物と平行に、かつ被洗浄物と わずかな間隙をもってフラットバー備えることにより、 フラットバーと被洗浄物の間で水膜を作り、超音波を被 洗浄物に効果的に伝達して被洗浄物を洗浄することが可 能となり、洗浄効率が向上する効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態の超音波洗浄機の正面図 (図1(1))と側面図(図1(2))である。

3

【図3】フラットバーの他の例の拡大断面図である。

【図4】超音波洗浄機の従来例の正面図(図4(1))

と側面図(図4(2))である。

【図5】従来の超音波洗浄機を複数台設置して洗浄を行

う例を示す図である。

【符号の説明】

1 超音波洗浄機

1 a 超音波発振器

1 b 超音波信号ケーブル

1 c 洗浄液供給パイプ

1 d 洗浄機本体

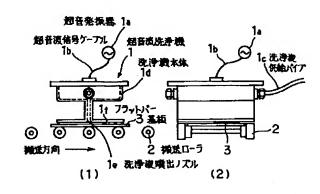
1 e 洗浄機噴出ノズル

1f フラットバー

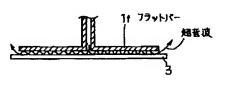
2 搬送ローラ

3 基板

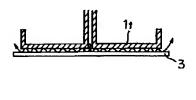




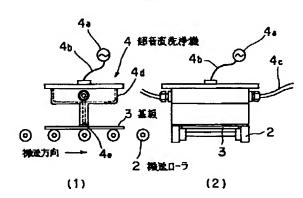




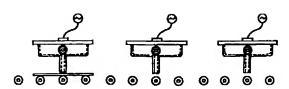
【図3】



【図4】



【図5】



<u>First Hit</u>

Previous Doc

Next Doc

Go to Doc#

End of Result Set

Generate Collection Print

L1: Entry 2 of 2

File: DWPI

Dec 22, 1997

DERWENT-ACC-NO: 1998-107269

DERWENT-WEEK: 199811

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Ultrasonic washer for silicon wafer, LC glass substrate - has jet nozzle whose flat bar with width same as length of cleaning liquid jet nozzle, prolongs along direction parallel to conveyance direction of substrate

PATENT-ASSIGNEE:

ASSIGNEE

CODE

KAIJO KK

KAIJN

PRIORITY-DATA: 1996JP-0150810 (June 12, 1996)

Search Selected Search ALL

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 09330896 A

December 22, 1997

003

Clear

H01L021/304

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DATE

APPL-NO

DESCRIPTOR

JP 09330896A

June 12, 1996

1996JP-0150810

INT-CL (IPC): $\underline{B06}$ \underline{B} $\underline{1/20}$; $\underline{B08}$ \underline{B} $\underline{3/12}$; $\underline{G03}$ \underline{F} $\underline{7/30}$; $\underline{H01}$ \underline{L} $\underline{21/304}$

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 09330896A

BASIC-ABSTRACT:

The washer (1) has a cleaning liquid jet nozzle (1e) which prolongs along right angle direction to the conveyance direction of a substrate (3) so that the substrate is cleaned. A set of clearances are provided at the end of the jet nozzle. A flat bar (1f) of the jet nozzle prolongs in a direction parallel to the conveyance direction of the substrate. The width of the flat bar is equal to the length of the jet nozzle.

ADVANTAGE - Improves efficiency of washer.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.1/5

TITLE-TERMS: ULTRASONIC WASHER SILICON WAFER LC GLASS SUBSTRATE JET NOZZLE FLAT BAR WIDTH LENGTH CLEAN LIQUID JET NOZZLE PROLONG DIRECTION PARALLEL CONVEY DIRECTION SUBSTRATE

DERWENT-CLASS: P43 P84 U11 U14

EPI-CODES: U11-C06A1B; U14-K01A5;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1998-086250

Previous Doc Next Doc Go to Doc#